

酸化膜CMP用 研磨スラリー

ILD™

酸化膜工程用ヒュームドシリカスラリー

ILD™ シリーズ

□ 特 長

- 砥粒の安定性向上（低スクラッチ性能）
- 高い機械研磨特性
- 希釈タイプ
- 高純度
- KOH/アンモニアベース



□ 物 性

	ILD3013	ILD3225
ケミカル	アンモニア	KOH
砥粒濃度 (wt%)	13.7	25.7
pH	10.5	11.0
粒子径 (nm)	85	85
粘度 (cP)	1.8	3.7
比重	1.08	1.17
希釈	原液使用タイプ	2倍希釈タイプ

※ ILD™はニッタ・ハース(株)の商標です。

※ 記載されている物性値等の数値は代表値を示しており、製品の規格を保証するものではありません。